(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international





(43) Date de la publication internationale 19 mai 2005 (19.05.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 2005/046296 A3

- (51) Classification internationale des brevets⁷: H05H 1/18
- (21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2004/002821

(22) Date de dépôt international :

3 novembre 2004 (03.11.2004)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

(30) Données relatives à la priorité:

0312934

4 novembre 2003 (04.11.2003) FR

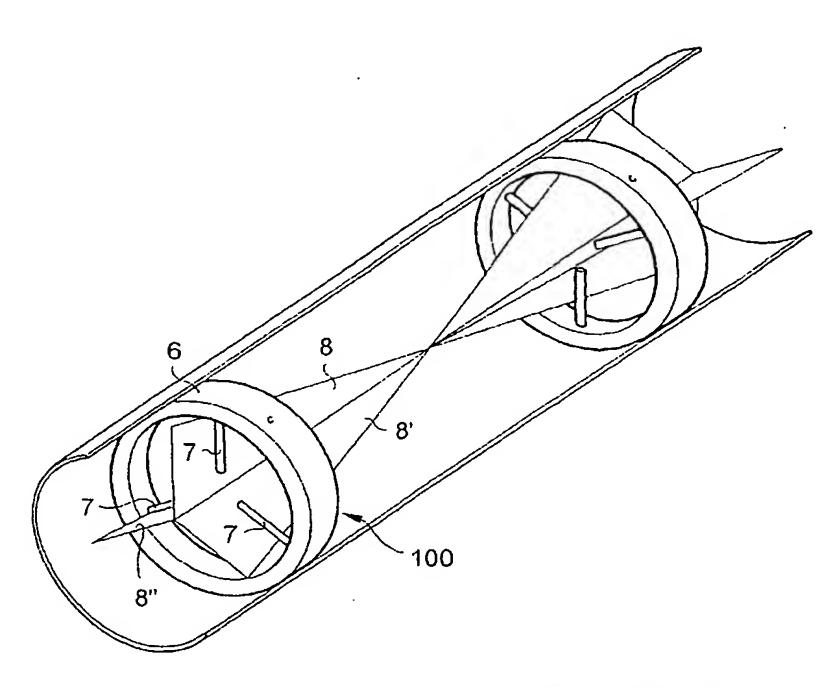
(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US): COM-MISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR]; 31/33, rue de la Fédération, F-75752 Paris Cedex 15 (FR).

- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): HITZ, Denis [FR/FR]; 5, avenue du Grand Châtelet, F-38100 Grenoble (FR). CORMIER, David [FR/FR]; 16, rue Saint Amable, F-63200 Riom (FR).
- (74) Mandataire : SANTARELLI; 14, avenue de la Grande-Armée, Boîte postale 237, F-75822 Paris Cedex 17 (FR).
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: DEVICE FOR CONTROLLING THE ELECTRONIC TEMPERATURE IN AN ECR PLASMA

(54) Titre: DISPOSITIF POUR CONTROLER LA TEMPERATURE ELECTRONIQUE DANS UN PLASMA RCE



(57) Abstract: The invention relates to a device which is used to control the electronic temperature in an ECR plasma chamber (1). The inventive device comprises at least one moderator (100) which is placed on the path of electrons having an energy greater than a pre-determined energy, such as to form an obstacle to said electrons. The invention is suitable for use in relation to ion sources and plasma machines.

[Suite sur la page suivante]

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

— avec rapport de recherche internationale

- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues
- (88) Date de publication du rapport de recherche internationale: 15 décembre 2005

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.